

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成27年7月2日(2015.7.2)

【公開番号】特開2014-229651(P2014-229651A)

【公開日】平成26年12月8日(2014.12.8)

【年通号数】公開・登録公報2014-067

【出願番号】特願2013-105985(P2013-105985)

【国際特許分類】

H 01 L 21/66 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/66 B

【手続補正書】

【提出日】平成27年5月13日(2015.5.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0020

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0020】

次に、ステップS4において、保護膜が形成される。保護膜となる膜は絶縁性膜である。この絶縁性膜は、電気的特性を評価する際に、熱的、化学的に安定であり、絶縁性能に優れた材料によって形成されることが好ましい。具体的には、フォトレジスト、絶縁性を有したシート(たとえば、ポリイミド、カプトン(登録商標)、ポリヘニルシリセスキオキサン、ポリビニルシリセスキオキサン)等であるが、これらに限られるものではない。なお、カプトンを適用する場合には、接着層を有するシート材が好ましい。